

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 2 区分

【発行日】平成23年10月13日 (2011.10.13)

【公表番号】特表2011-502795(P2011-502795A)

【公表日】平成23年1月27日 (2011.1.27)

【年通号数】公開・登録公報2011-004

【出願番号】特願2010-534069(P2010-534069)

【国際特許分類】

B 2 3 K 26/36 (2006.01)

B 2 3 K 26/06 (2006.01)

B 2 3 K 26/00 (2006.01)

【F I】

B 2 3 K 26/36

B 2 3 K 26/06 J

B 2 3 K 26/00 M

【手続補正書】

【提出日】平成23年8月24日 (2011.8.24)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

レーザ加工されたツールを生成するためのシステムであって、

レーザ光画像を生成するレーザと、

ほぼ円筒形のワークであって、該システムが該ワークを回転させることが可能な、ワークと、

該レーザ光画像を処理し、かつ処理されたレーザ光画像を該ワークの外側表面上に結像するための光学系と、を含み、

該レーザ光画像の該処理は該ワークの該外側表面の曲率に関係しており、かつ

該レーザ光画像は、該表面内にミクロ構造を生じさせてほぼ円筒形のツールを形成するために、該ワークの該外側表面をアブレーションすることが可能である、システム。

【請求項 2】

レーザ加工されたツールを生成するためのシステムであって、

レーザ光画像を生成するレーザと、

ほぼ円筒形のワークであって、該システムが該ワークを回転させ、かつ該ワークを該レーザ光に対して動かすことが可能な、ワークと、

該レーザ光画像を該ワークの外側表面上に結像するための光学系と、を含み、

該システムが、該表面内にミクロ構造を生じさせてほぼ円筒形のツールを形成するように、該レーザ光画像を使用して該ワークの該外側表面をアブレーションするために、該レーザ光画像に対する該ワークの回転運動及び並進運動を、該レーザの作動に同調させることが可能であり、

該レーザ光画像は、該ワークの該外側表面に対して垂直な方向に 20 マイクロメートル未満の偏差を有する、システム。